熔体甩带系统 PA 500



说明

• 半自动熔体甩带系统，处理量为 100 至 500 g，具体取决于合金及熔炼温度
• 高真空或惰性气体气氛
• 水冷铜制甩带轮、水冷坩埚支架，配氮化硼或石英坩埚
• 坩埚定位系统，使喷嘴与甩带轮之间的距离精确、可重复，并实现熔体的半自动喷射

AI翻译，仅供参考

• 控制面板（触摸屏）
• 通过软件控制压力

• 集成温度控制
• 通过软件自动对腔体抽真空及吹扫
• 压力参数可独立编程
• 紧凑系统，带可移动机架、内置涡轮分子泵或前级泵及高真空计。
配齐电源、带材收集容器、阀门及全部安全功能

详细信息

最大处理量:	100 - 500 g
温度范围:	最高 1500°C
真空度:	< 10^-2 至 10^-5 mbar
电源功率:	30 kW
甩带轮:	铜制、水冷，直径 250 × 60 mm
坩埚:	氮化硼或石英

AI翻译，仅供参考